【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成18年12月14日(2006.12.14)

【公開番号】特開2005-132660(P2005-132660A)
【公開日】平成17年5月26日(2005.5.26)
【年通号数】公開・登録公報2005-020
【出願番号】特願2003-369522(P2003-369522)
【国際特許分類】
Ｃ０３Ｂ　11/08　(2006.01)
Ｃ０３Ｂ　11/00　(2006.01)
Ｃ０３Ｂ　40/02　(2006.01)
Ｃ０３Ｃ　15/00　(2006.01)
Ｃ０３Ｃ　17/06　(2006.01)
Ｃ０３Ｃ　17/22　(2006.01)
Ｇ０２Ｂ　3/00　(2006.01)
Ｇ０２Ｂ　5/02　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０３Ｂ　11/08
Ｃ０３Ｂ　11/00　Ｎ
Ｃ０３Ｂ　40/02
Ｃ０３Ｃ　15/00　Ａ
Ｃ０３Ｃ　17/06　Ｚ
Ｃ０３Ｃ　17/22　Ｚ
Ｇ０２Ｂ　3/00　Ｚ
Ｇ０２Ｂ　5/02　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成18年10月30日(2006.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
図６（ａ）に示すように、まず、チャンバー１５で覆われ、雰囲気ガス導入口１８からN_2ガスを導入した成形機の上ヘッド５に、上記した無反射構造成形用レプリカ金型２２を上型６として固定し、当該上型６をプレスステージ８と共に所定の温度（ここでは、５９０℃）まで昇温した。また、予熱ステージ７も５９０℃まで昇温した。そして、上記した下金型４を下型１０として用い、１５ｍｍ×１５ｍｍ×１．０ｍｍのクラウン系の硼珪酸ガラス（転移点（Ｔｇ）：５０１℃、屈伏点（Ａｔ）：５４９℃）を、光学材料１１として下型１０の上に載せ、光学材料１１が載せられた下型１０を、チャンバー１５の金型投入口１２から成形機内に投入して、５９０℃に設定された予熱ステージ７で３分間加熱した。ここで、光学材料１１の表面には、離型のためのチッ化硼素（ＢＮ）微粒子離型剤２１が塗布されている（図７（ａ）参照）。